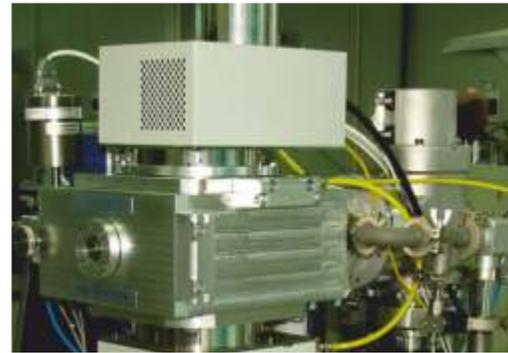


## МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ICP ИСТОЧНИКОМ

### МВУ ТМ ПЛАЗМА 03

**Назначение:** Плазмохимическое селективное (реактивно-ионное, анизотропное) травление диэлектрических и металлических плёнок.



#### Особенности:

- Индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле: до  $\varnothing$  150 мм – 1 шт.;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ в диапазоне 30 – 200 Вт;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ ICP источника плазмы в диапазоне 400 – 600 Вт;
- Рабочие газы: Ar, SF<sub>6</sub>, O<sub>2</sub>, CF<sub>4</sub>;
- Безмасляная система откачки;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 5,5 кВт.

